

# Soporte Para Obleas De Silicio De Ptfе Para Procesos De Grabado Ácido Y Limpieza 2 4 6 8 Pulgadas Personalizable Resistente A Altas Temperaturas

Número de artículo: PL-CP158



## Introducción

Soportes de obleas de silicio de PTFE de alta pureza diseñados para procesos extremos de grabado ácido y limpieza. Optimizados para obleas de 2 a 8 pulgadas, estos portadores robustos personalizables garantizan un manejo sin contaminación y estabilidad térmica en los entornos de fabricación de semiconductores más exigentes para adquisiciones B2B.

[Aprende más](#)

Aplicación	Descripción	Beneficio clave
Grabado de semiconductores	Manejo de obleas en soluciones concentradas de HF o BOE (grabado de óxido tamponado) para eliminar capas dieléctricas.	Resistencia excepcional a ácidos agresivos garantiza la durabilidad del portador a largo plazo.
Procesos de limpieza RCA	Uso de soluciones SC-1 y SC-2 a altas temperaturas para eliminar contaminantes orgánicos y metálicos.	Alta estabilidad térmica evita deformaciones durante baños oxidativos a alta temperatura.
Producción de células fotovoltaicas	Texturizado y limpieza de obleas de silicio durante la fabricación de células solares de alta eficiencia.	Diseño robusto maneja un rendimiento industrial de alto volumen con una fiabilidad constante.
Fabricación de MEMS	Sujeción segura de sustratos durante procesos complejos de grabado iónico profundo reactivo y liberación en húmedo.	Ranuras mecanizadas de precisión protegen estructuras micromecánicas delicadas de daños por contacto.
Limpieza por grabado con piraña	Procesamiento de obleas en una mezcla de ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno para eliminar compuestos orgánicos pesados.	Los materiales son inmunes a ataques oxidativos fuertes, evitando la degradación del equipo.
Investigación en nanotecnología	Manejo especializado de sustratos personalizados en deposición química de vapor experimental o procesamiento en fase líquida.	La personalización completa admite tamaños de oblea no estándar y soporte para geometrías únicas.
Montaje de optoelectrónica	Limpieza de obleas de zafiro o GaAs antes del crecimiento epitaxial o la deposición de películas delgadas.	La pureza del material PTFE elimina el riesgo de interferencia de metales traza en dispositivos ópticos.

Categoría de especificación	Detalles de parámetros para PL-CP158	Disponibilidad/Opciones
<b>Serie de modelo</b>	Portador de obleas de silicio PL-CP158	Diseños estándar y personalizados
<b>Material principal</b>	PTFE (Politetrafluoroetileno) de alta pureza	Opciones de PFA disponibles bajo solicitud
<b>Tamaños de oblea compatibles</b>	2 pulgadas, 4 pulgadas, 6 pulgadas, 8 pulgadas	Totalmente personalizable a cualquier diámetro
<b>Configuración de ranuras</b>	Capacidad y paso se definen por proyecto	Personalizado según especificaciones del usuario
<b>Rango de temperatura</b>	Operativo desde niveles criogénicos hasta 260°C	Personalización dependiente del proceso
<b>Resistencia química</b>	Gama completa de ácidos, bases y disolventes	Compatibilidad química universal
<b>Método de fabricación</b>	Mecanizado de precisión CNC de 5 ejes	Geometría a medida disponible

Aplicación	Descripción	Beneficio clave
<b>Categoría de especificación</b>	<b>Detalles de parámetros para PL-CP158</b>	<b>Disponibilidad/Opciones</b>
<b>Características de drenaje</b>	Puertos de drenaje inferiores/laterales personalizables	Optimizados para caudales específicos de baño
<b>Diseño de asidero</b>	Asideros desmontables o integrados manuales/robóticos	Personalizados para compatibilidad con herramientas
<b>Grado de pureza</b>	Análisis de trazas y grado para semiconductores	Materiales de alta pureza certificados